采购内容、数量

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **数量** | **详细技术参数** |
| 1 | 精密磨抛机 | 1台 | 精密磨抛机用于SEM在观察金相组织和材料缺陷时需要经过殊的样品制备方法的设备，适用于样品内部结构观察和各类分析。1.指标及功能要求★1）研磨精度：≤0.01μm；★2）最大样品尺寸：直径≥50mm，高度≥10mm；★3）加工速度500μm/H（6KV）；4）离子束直径500μm(FWHM)；5）样品台：可拆卸式多功能样品台；6）截面样品摆动角度：±15°±30°±40°；平面样品摆动角度：±60°±90°；7）截面样品摆动速度：6°/s, 60°/s； 8）倾斜角度：0-90°；9）改变加工区域宽度：通过改变样品摆动角度调整，无需调整离子枪；10前处理工具：多功能研磨工具，可研磨出平整平面；11）离子源：氩气（99.99%）；★12）加工模式：同时具备间歇式加工和连续加工。2.系统组成包括设备本体、机械泵、复合型研磨仪、PLUS离子枪、液晶触摸屏控制系统等。3.其它要求1）离子枪数：1个，且在工作时间内可不间断发射离子束和间断发射离子束；2）操作方式：触摸式，可预设加工时间和进行二次加工；3）随机器有专用工具若干、专用样品台若干。 |